

اثر یون منیزیم بر انتقال دی ان ای از نانو حفره سیلیکون نیتريد

بهرامی، نوید¹

عبدالوهاب، روح اله²

¹دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت، انتهای خیابان علم و صنعت، تهران

²دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت، انتهای خیابان علم و صنعت، تهران

چکیده

در این رساله با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی به بررسی اثر اضافه کردن یون منیزیم بر زمان جابجایی دی ان ای دو رشته ای از نانو حفره سیلیکون نیتريد تحت میدان پرداخته شده است. این شبیه سازی به منظور کاهش سرعت عبور دی ان ای از نانو حفره برای افزایش دقت تشخیص نوکلوتیدها مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده هنگام عبور دی ان ای از نانو حفره سیلیکون نیتريد بدون استفاده از محلول منیزیم، دی ان ای به سرعت از نانو حفره عبور می کند. در حالی که با اضافه کردن محلول منیزیم و کاهش بار سطحی دی ان ای، زمان عبور دی ان ای از نانو حفره حدود 30 درصد افزایش می یابد و دقت تشخیص نوکلوتیدها نیز بیشتر می شود. در این رساله از روش اعمال میدان با اعمال اختلاف پتانسیل 20 ولت برای هدایت دی ان ای دو رشته ای استفاده شده است که دی ان ای متشکل از A₉ و T₉ و قطر نانو حفره 2.4 نانومتر می باشد.

Effect of Mg²⁺ on DNA translocation in silicon nitride nanopores

Bahrami, Navid¹

Abdolvahab, Rouhollah²

¹ Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Tehran,

² Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Tehran

Abstract

In this dissertation, using molecular dynamics simulations, the effect of adding Mg²⁺ on the translocation time of dsDNA from silicon nitride nanopores under the field is investigated. This simulation has been investigated to reduce the velocity of DNA passing through nanopores to increase the accuracy of nucleotide detection. According to the results, when DNA passes through a silicon nitride nanopore without using magnesium solution, the DNA passes through the nanopore rapidly, while by adding magnesium solution and reducing the surface charge of the DNA, the translocation time of the DNA through nanopore increase about 30% and the accuracy of nucleotide detection increases. In this dissertation, a field application method with a potential difference of 20 volts is used to conduct dsDNA, which DNA consists of A₉ and T₉ and a nanopore diameter of 2.4 nm.

مقدمه

است. توالی یابی با تکنیک هایی ارزان تر و سریع تر نقش چشمگیری در درمان بیماری و پزشکی دارد، علاوه بر این می توان به درک بهتر ما از وراثت و همچنین تکامل زیست شناسی کمک می کند. توالی یابی دی ان ای بر پایه نانو حفره یکی از

هدف از توالی یابی دی ان ای دست یابی به ترتیب ساختار دی ان ای، شامل جفت بازهای آدنین-تیمین و سیتوزین-گوانین

دستاوردهای مهم در زمینه توالی یابی است. نانو حفره حالت جامد به دلیل هزینه پایین و توالی عملیاتی بالا به عنوان نسل بعدی در تعیین توالی دی ان ای مورد توجه قرار گرفته اند. [1]

در تعیین توالی دی ان ای، عبور مولکول دی ان ای از نانو حفره چالشی بسیار پیچیده است که تحت تاثیر عوامل متعددی چون غلظت یون در محیط [2]، ضخامت نانو حفره و قطر نانو حفره [3] قرار دارد. روش شبیه سازی دینامیک مولکولی، یک ابزار مکمل برای مطالعه عبور دی ان ای از نانو حفره ها است. در این رساله، مطالعات محاسباتی در تعیین توالی دی ان ای با استفاده از نانو حفره سیلیکون نیترا انجام شده است.

این مطالعه شامل عبور یک دی ان ای دو رشته ای متشکل از بازهای آدنین و تیمین که از نانو حفره سیلیکون نیترا با قطر 2.4 نانومتر عبور می کند. این شبیه سازی یکبار در محلول سدیم با غلظت یک مولار انجام می شود و بار دیگر با ثابت نگهداشتن همه شرایط فقط با اضافه کردن محلول منیزیم با غلظت 0.6 مولار به محلول یک مولار سدیم شبیه سازی را دوباره تکرار میکنیم تا اثر اضافه شدن بار کاتیون بر عبور دی ان ای را مورد بررسی قرار دهیم. از اعمال میدان الکتریکی برای کشیدن دی ان ای به داخل نانو حفره استفاده شده است.

در شکل 1 ساختار شبیه سازی شامل سیلیکون نیترا و دی ان ای دو رشته ای قرار داده شده در جعبه آبی دیده می شود که برای وضوح بیشتر مولکول های آب حذف شده اند. در شکل 1 همچنین مراحل عبور دی ان ای از نانو حفره نشان داده شده است. قطر نانو حفره حدود 10 نانومتر قطر حفره آن 2.4 نانومتر و ارتفاع حدود 10 نانومتر دارد. ساخت نانو حفره سیلیکون نیترا توسط پکیج وی ام دی انجام شده است. هر دو سیستم ابتدا 50000 گام مینیمایز می شود. از باروستات و ترموستات برای اعمال فشار و دمای ثابت در یک اتمسفر و 297 کلون استفاده شده است.

اعمال میدان در جهت Z است تا جهت حرکت دی ان ای در همین جهت صورت پذیرد. در روش اعمال میدان از یک اختلاف پتانسیل 20 ولتی برای شبیه سازی میدان استفاده شده است. غلظت محلول سدیم 1 مولار است و در آزمایش دوم یک محلول 0.6 مولار منیزیم به آن اضافه می شود تا اثر کاتیون بر زمان عبور دی ان ای بررسی شود.

دی ان ای دارای بار منفی است و وقتی در میدان قرار میگیرد در جهت عکس میدان شروع به حرکت میکند حضور یک یون دوبار مثبت در محیطی که دی ان ای در آن حرکت می کند سبب آن می شود که بار سطحی دی ان ای کاهش یابد و در نتیجه اثر میدان بر دی ان ای کمتر شده و زمان عبور بیشتر شود.

نتایج و تفسیر آن ها

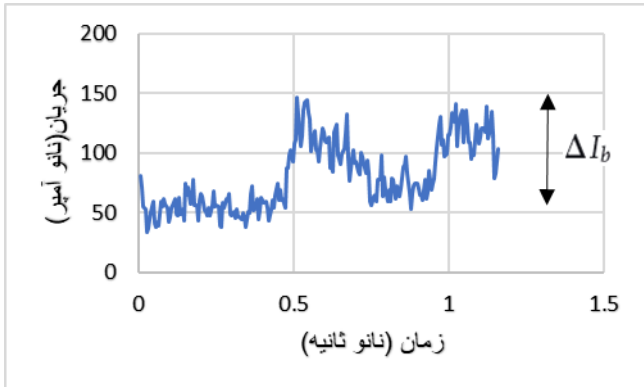
در این قسمت نتایج به دست آمده از عبور دی ان ای دو رشته ای از نانو حفره سیلیکون نیترا در دو حالت بدون یون منیزیم و با وجود یون منیزیم را ارائه میدهم.

پس از به تعادل رسیدن جعبه شبیه سازی شده که متشکل از نانو حفره سیلیکون نیترا، آب، یون سدیم کلرید و دی ان ای دو رشته ای متشکل از آدنین و تیمین فرآیند عبور از نانو حفره سیلیکون به قطر 2.4 نانومتر تحت میدان 20 ولتی که به دو سر نانو حفره به طول حدود 10 نانومتر (36 واحد سلولی از سیلیکون نیترا) و قطر حدود 10 نانومتر که به صورت 6 گوش هست اعمال می شود. در شکل 1 شش موقیعت از دی ان ای درون نانو حفره که در جهت محور Zها یعنی به سمت پایین کشیده شده است نمایش داده شده است که برای سهولت مشاهده دی ان ای

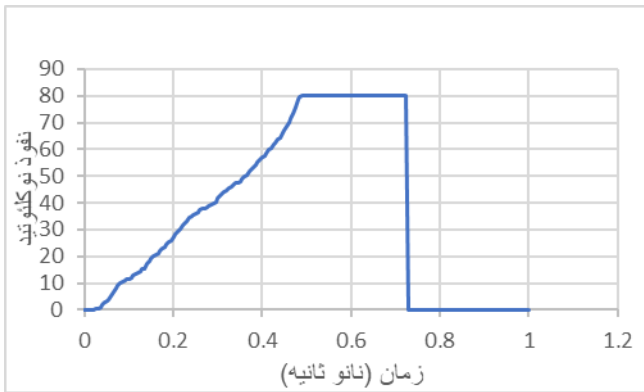
روش تحقیق

در این رساله از شبیه ساز دینامیک مولکولی نمود به منظور شبیه سازی سیستم استفاده شده است. برای آماده سازی اولیه سیستم نظیر آماده کردن فایل مختصات ورودی PDB, PSF حل کردن سیستم در جعبه آب، اضافه کردن یون به سیستم و آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی دینامیک مولکولی توسط نمود از نرم افزار وی ام دی و برای رستم نمودارها از اکسل استفاده شده است. همچنین از میدان نیرو چارم 27 و مدل TIP3P به ترتیب برای مدل سازی دی ان ای و آب استفاده شده است.

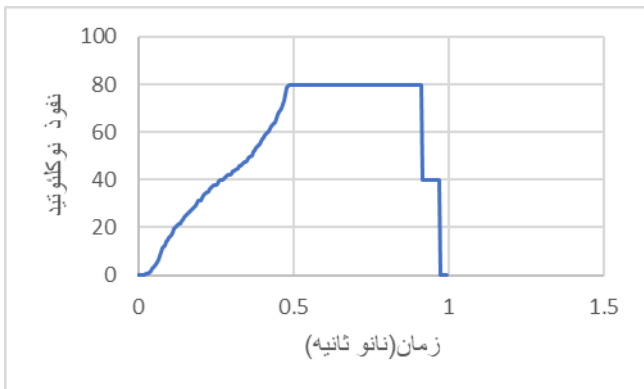
شکل 2: نمودار جریان بر حسب زمان برای حالت بدون Mg



شکل 3: نمودار نفوذ بر حسب زمان با Mg



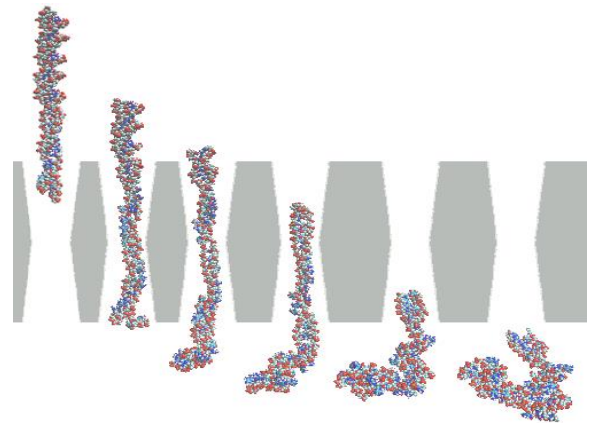
شکل 3: نمودار نفوذ دی ان ای درون حفره بر حسب زمان بدون حضور Mg^{2+}



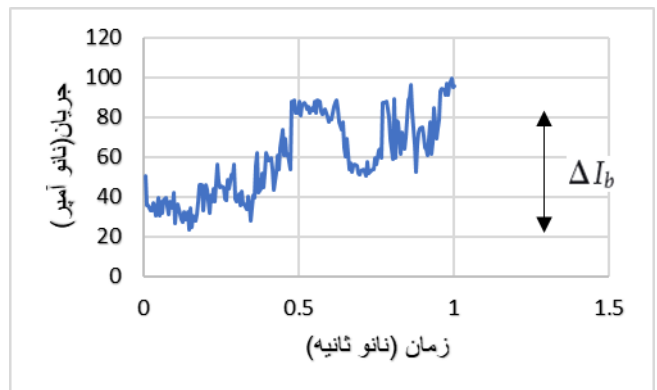
شکل 3: نمودار نفوذ دی ان ای درون حفره با وجود Mg^{2+}

یون ها، نانو حفره و آب از آن حذف شده است. نمودار مربوط به شدت افت جریان در طول حرکت دی ان ای در شکل 2 و 3 و نمودار مربوط به تعداد نوکلئوتید عبور کرده از دی ان ای در شکل 4 و 5 نمایش داده شده است. همان طور که از شکل های 2 و 3 مشخص است شدت افت جریان تغییر چندانی نکرده است اما از مقایسه شکل 4 و 5 مشخص است که زمان عبور که در آزمایش اول حدود 0.6 نانو ثانیه بوده به تقریباً 0.9 نانو ثانیه اضافه شده است، تقریباً حدود 30 درصد اضافه شده است که با نتایج تجربی بدست آمده تطابق دارد. [2] زمان عبور به دلیل کم شدن بار سطحی منفی دی ان ای در حضور منیزیم کاهش پیدا کرده است که سبب کاهش سرعت دی ان ای می شود و در نتیجه توالی یابی دی ان ای خیلی راحت تر امکان پذیر است.

جدولها و شکل ها



شکل 1: مراحل عبور دی ان ای از نانو حفره سیلیکون نیترات



نتیجه گیری

با توجه به اینکه در هنگام توالی یابی دی ان ای در حضور نانو حفره کنترل سرعت دی ان ای و کاهش سرعت آن یک چالش مهم و جدی محسوب می شود افزودن یونی که بتواند بار سطحی دی ان ای را کاهش دهد یک روش کار آمد برای کنترل سرعت دی ان ای محسوب می شود. البته استفاده از یون های دو ظرفیتی مانند منیزیم و کلسیم و یون های سه ظرفیتی مانند آلومینیوم و کبالت به دلیل عدم حرکت دی ان ای دارای محدودیت می باشد.

مرجع ها

- [1] Ulrich F. Keyser*, Controlling molecular transport through nanopores, <http://rsif.royalsocietypublishing.org/> on February 15, 2015. (doi:10.1098/rsif.2011.0222)
- [2] J. Uplinger, B. Thomas, R. Rollings, D. Fologea, D. McNabb, J. Li, K+, Na+, and Mg2+ on DNA translocation in silicon nitride nanopores, *Electrophoresis* 2012, 33, 3448–3457.
- [3] P. G. Debendetti and E. H. Stanley; "Supercooled and Glassy Water"; *Physics Today* **56**, No. 3 (2003) 40-46.